### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-316225

(43)公開日 平成7年(1995)12月5日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号 F I

技術表示箇所

C 0 8 F 8/42

MHU

審査請求 未請求 請求項の数1 〇L (全 12 頁)

(21)出願番号	特願平6-111228	(71)出願人 000005968
		三菱化学株式会社
(22)出願日	平成6年(1994)5月25日	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
		(72)発明者 五十野 善信
		新潟県長岡市上富岡町1603-1 長岡技術
		科学大学内
		(72)発明者 高野 敦志
		新潟県長岡市上富岡町1603-1 長岡技術
		科学大学内
		(72)発明者 冨田 雅之
		三重県四日市市東邦町1番地 三菱油化株
		式会社四日市総合研究所内
		(74)代理人 弁理士 津国 肇 (外1名)

### (54) 【発明の名称】 共重合体の製造方法

# (57)【要約】

【構成】 下記の成分(a)及び成分(b)を、Si-H結合を2個以上有するシラン又はSi-H結合を2個以上有するポリオルガノハイドロジェンシロキサンを用いて結合させるブロック共重合体の製造方法。

(a) 下記の一般式 (I) で示されるアニオン重合開始 剤を用いて得られる分子鎖末端に不飽和結合を有する芳 香族ピニル化合物ポリマー

 $CH_2 = CH - R^1 - M$ 

(1)

(式中、 $R^1$  は炭素数  $3 \sim 20$  の炭化水素基を表し、M はアルカリ金属原子を表す)

(b) 分子鎖末端に不飽和結合を有するオレフィン系ポリマー

【効果】 得られるブロック共重合体は、それ自体優れた耐衝撃性と機械的強度を有する熱可塑性樹脂であり、かつポリオレフィン、ポリメチレン又はポリフェニレンエーテル等の優れた改質材又はそれらの相溶化剤である。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記の成分(a)及び成分(b)を、S i-H結合を2個以上有するシラン又はSi-H結合を2個以上有するポリオルガノハイドロジェンシロキサンを用いて結合させることを特徴とするブロック共重合体の製造方法。

# (a) 下記の一般式(I)

$$CH_2 = CH - R^1 - M \tag{1}$$

(式中、R<sup>1</sup> は炭素数3~20の炭化水素基を表し、M の分子切断 はアルカリ金属原子を表す)で示されるアニオン重合開 10 はいい難い。 始剤を用いて得られる、分子鎖末端に不飽和結合を有す 【0008】 る芳香族ビニル化合物ポリマー として、カミ

(b) 分子鎖末端に不飽和結合を有するオレフィン系ポリマー

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、分子鎖末端に不飽和結合を有する芳香族ビニル化合物ポリマーと分子鎖末端に不飽和結合を有するオレフィン系ポリマーとを結合させるブロック共重合体の製造方法に関する。

【0002】これにより得られるブロック共重合体は、それ自体が優れた耐衝撃性を有する熱可塑性樹脂であるとともに、ポリオレフィン、ポリスチレン又はポリフェニレンエーテル等に対する優れた改質剤並びにポリフェニレンエーテルとポリオレフィン乂はポリオレフィンとハイインパクトポリスチレンとの優れた相溶化剤でもある。

#### [0003]

【従来の技術】 αーオレフィン(本発明では、エチレンを包含するものとする)の単独重合体又はその共重合体 30 は、廉価であることに加えて、優れた機械的強度、光沢、透明性、成形性、耐湿性及び耐薬品性を有しているので、単独で、又はポリマーブレンド成分として汎用されている。しかしながら、αーオレフィン重合体は分子構造が非極性であるため他物質との親和性に乏しく、接着性、印刷性又はポリマーブレンドでの相溶性が著しく劣っている。

【0004】これを改善するために、 $\alpha$ -オレフィン重合体にラジカル重合可能な単量体をグラフト重合させて変性重合体を製造する方法が古くから数多く試みられて 40 きた。

【0005】しかし、一般にラジカルグラフト重合法はグラフト率やグラフト効率が十分に高くなく、また多くの場合、有機若しくは無機過酸化物などのラジカル重合開始剤が使用されるので、グラフト重合されるべき幹ポリマーの分子切断や架橋反応が生じやすい等多くの問題を有している。

【0006】このような点を解決することを目的として 種々の提案がなされている。例えば特開昭57-985 08号及び特開平2-269110号各公報には、α-50 オレフィンと非共役ジエンモノマーとの共重合体の不飽 和結合の反応性を利用して、幹ポリマーの分子切断や架 橋を抑えて単量体のグラフト率を高めることが開示され ている。

【0007】しかしながら、この不飽和共重合体は、共重合性が必ずしも高くない非共役ジエンモノマーであり、更にこの不飽和共重合体へのラジカルグラフト反応は、単量体のグラフト率、グラフト効率又は幹ポリマーの分子切断等の観点で実用上必ずしも完成されているとはいい難い

【0008】また、ラジカルグラフト重合法以外の方法として、カミンスキー型チーグラー・ナッタ触媒で得られるポリオレフィンの分子鎖末端二重結合へハロゲンを付加させ、それとリビングポリスチリルリチウムとのカップリング反応により $\alpha$ -オレフィンとスチレンとのブロック共重合体を得る方法(特開昭62-158709号公報)が知られている。

【0009】しかし、この方法は製造された共重合体中に未反応のハロゲンが残存するため、押出成形や射出成 20 形のように溶融混練すると共重合体の着色や劣化が起り やすい。

【0010】更に、アニオン重合活性点とチーグラー・ナッタ型重合活性点とのいわゆる活性点変換法により、ポリオレフィンとポリスチレン又はポルブタジエンとのブロック共重合体を得る方法(特開昭60-20918号公報、Eur. Polym. J. 17,1175,1981、Makromol. Chem. 181,1815,1980)も知られている。

【0011】しかし、これらの方法は活性点変換効率が低い(約10%)ことによるプロック共重合効率の低下、また目的とする制御された分子量の共重合体を得ることが難しいことなどの種々の問題点を有している。

【0012】また分子鎖末端に不飽和結合を有する $\alpha$  - オレフィン重合体とアニオン重合性モノマーとからプロック共重合体を得る方法(特開平5-39331号公報)も知られているが、アニオン重合可能な条件で、ポリオレフィンが重合溶媒に溶ける必要があり、使用できるポリオレフィンの分子量及び立体規則性が制限される。

### [0013]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記問題点を解決し、分子切断又はゲル化の発生がなく、かつ高い共 重合効率を有する共重合体の製造方法を提供することを 目的とする。

### [0014]

【課題を解決するための手段】本発明は、下記の成分 (a) 及び成分 (b) を、Si-H結合を2個以上有するシラン又はSi-H結合を2個以上有するポリオルガノハイドロジェンシロキサンを用いて結合させることを特徴とするブロック共重合体の製造方法である。

【0015】 (a) 下記の一般式 (I)

(3)

3

[0016]

 $CH_2 = CH - R^1 - M$ (I)

【0017】 (式中、R<sup>1</sup> は炭素数3~20の炭化水素 基を表し、Mはアルカリ金属原子を表す)

【0018】で示されるアニオン重合開始剤を用いて得 られる、分子鎖末端に不飽和結合を有する芳香族ビニル 化合物ポリマー

【0019】(b)分子鎖末端に不飽和結合を有するオ レフィン系ポリマー

【0020】以下、本発明を詳細に説明する。

【0021】 <成分(a)>

(1) アニオン重合開始剤

本発明で使用するアニオン重合開始剤は、一般式(I) で示される化合物である。

[0022]

$$CH_2 = CH - R^1 - M \tag{I}$$

【0023】(式中、R<sup>1</sup> は炭素数3~20の炭化水素 基を表し、Mはアルカリ金属原子を表す)

【0024】上式において、R1の炭素数は好ましくは 3~15、より好ましくは3~10である。

【0025】Mの具体例としてはリチウム、ナトリウ ム、カリウム等のアルカリ金属原子が挙げられ、このう ち好ましくはリチウム原子である。

【0026】上記アニオン重合開始剤(I)の合成方法 は、特に限定されないが、通常下記一般式(II)で示さ れる化合物とアルカリ金属とを反応させて得ることがで きる。

[0027]

$$CH_2 = CH - R^1 - X \tag{II}$$

基を表し、Xはハロゲン原子を表す)

【0029】このアニオン重合開始剤(I)の具体例と しては、4-ペンテニルリチウム、5-ヘチセニルリチ ウム、7-オクテニルリチウム、4-ペンテニルナトリ ウム、5-ヘキセニルナトリウム、4-ペンテニルカリ ウム、5-ヘキセニルカリウム等が挙げられるが、好ま しいものは4-ペンテニルリチウムである。

【0030】(2) 芳香族ビニル化合物

芳香族ビニル化合物の具体例としては、例えば、スチレ ルスチレン、ジメチルスチレン、2、4、6-トリメチ ルスチレン、クロロスチレン、ジクロロスチレン、ブロ モスチレン、ニトロスチレン、クロロメチルスチレン、 シアノスチレン、tープチルスチレン、ビニルナフタレ ン等が挙げられ、中でもスチレン、α-メチルスチレ ン、メチルスチレンが好ましい。これらは単独又は2種 以上併用して用いることができる。

【0031】また、これら芳香族ビニル化合物と共重合 可能なモノマーを50モル%を超えない範囲で共重合さ ック等、いずれの形態で共重合されていてもよい。これ らの具体例としては、ブタジエン、イソプレン、メタク リル酸エステル、ヘキサメチルシクロトリシロキサン等 である。

【0032】(3)分子鎖末端に不飽和結合を有する芳 香族ビニル化合物ポリマー(a)の製造

上記アニオン重合開始剤(I)を用いて芳香族ビニル化 合物を重合させる条件は-100~200℃、好ましく 10 の温度で常圧下、減圧下又は加圧下で行うことができ る。

【0033】上記重合において使用することができる溶 媒としては、例えば、n-ヘキサン、n-ヘプタン等の 脂肪族炭化水素;シクロヘキサン、デカヒドロナフタレ ン等の脂環式炭化水素;ベンゼン、トルエン、o-、m -若しくはp-キシレン等の芳香族炭化水素;テラトヒ ドロフラン、ジオキサン、エチルエーテル、ピリジン、 ジグリム等の非プロトン性極性溶媒;などが使用でき る。これらの溶媒は、単独でも、また混合物でもよい。

【0034】この分子鎖末端に不飽和結合を有する芳香 族ビニル化合物ポリマー (a) の分子量は任意である が、一般的にはゲルパーミエーションクロマトグラフィ ー(以下「GPC」という)測定による数平均分子量 (以下「Mn」という)で500~1,000,00 0、好ましくは500~500,000、より好ましく は1,000~100,000である。

【0035】 <成分(b)>

(1) α-オレフィン

本発明で使用する成分(b)の分子鎖末端に不飽和結合 【0028】(式中、 $R^{\scriptscriptstyle extsf{I}}$  は炭素数 $3\sim20$ の炭化水素 30 を有するオレフィン系ポリマーは、炭素数 $2\sim12$ 、好 ましくは2~8のα-オレフィンの単独重合体又はそれ らを主成分とする共重合体である。これらα-オレフィ ンの具体例としては、エチレン、プロピレン、1-ブテ ン、1-ヘキセン、3-メチル-1-ブテン、3-メチ ルー1ーペンテン、4ーメチルー1ーペンテン、3,3 ージメチルー1ーブテン、4,4ージメチルー1ーペン テン、3-メチル-1-ヘキセン、4-メチル-1-ヘ キセン、4,4-ジメチル-1-ヘキセン、5-メチル -1-ヘキセン、アリルシクロペンタン、アリルシクロ ン、 $\alpha$ -メチルスチレン、 $\alpha$ -メトキシスチレン、メチ 40 ヘキサン、アリルベンゼン、3-シクロヘキシル-1-ブテン、ビニルシクロプロパン、ビニルシクロヘキサ ン、2-ビニルビシクロ〔2、2、1〕-ヘプタンなど を挙げることができる。これらのうち好ましい例として は、エチレン、プロピレン、1-ブテン、1-ヘキセ ン、3-メチル-1-ブテン、3-メチル-1-ペンテ ン、4-メチル-1-ペンテン、3-メチル-1-ヘキ センなどを挙げることができ、特にエチレン、プロピレ ン、1-プテン、1-ヘキセン、3-メチル-1-プテ ン又は4-メチル-1-ペンテンが好ましい。これらの せ用いてもよい。これらのモノマーはランダム又はブロ50 $\alpha$ -オレフィンは1種でもよく、2種類以上用いてもさ

しつかえない。 2種以上の $\alpha$  - オレフィンを用いる場合は、これらの $\alpha$  - オレフィンが不飽和重合体中にランダムに分布していてもよく、あるいはブロック的に分布していてもよい。

【0036】(2)分子鎖末端に不飽和結合を有するオレフィン系ポリマー(b)の製造

本発明で使用する分子鎖末端に不飽和結合を有するオレフィン系ポリマー (b) は下記の2種の方法によって製造できる。

【0037】①チーグラー・ナッタ型触媒を用いて上記 10  $\alpha$  - オレフィンと  $\alpha$  ,  $\omega$  - ジエンとを共重合させる方法。この場合、使用する  $\alpha$  ,  $\omega$  - ジエンの具体例としては、1 , 9 - デカジエン、1 , 13 - テトラデカジエン、ジビニルベンゼン等が挙げられ、これらのジエンの\*

\*共重合量は特に制限はないが $0.01\sim30$ モル%、好ましくは $0.05\sim20$ モル%である。0.01モル% 未満では成分(a)との結合反応時にプロック共重合体生成率が低くなり、30モル%を超えると $\alpha$ -オレフィンと $\alpha$ ,  $\omega$ -ジエン共重合時にゲル化等が発生しやすい。これらの $\alpha$ ,  $\omega$ -ジエンは単独でも又は2種類以上を用いてもさしつかえない。

6

【0038】②下記成分(i)及び(ii)からなる触媒を用い上記αーオレフィンを重合させる方法。

(i) 成分(i) は共役五員環配位子を少なくとも1個有する周期律表IVB~VIB族遷移金属化合物である。具体的には、下記一般式(III)又は一般式(IV)で示される。

[0039]

 $Q_{a} \quad (C_{5} \quad H_{5-a-b} (R^{2})_{b}) \quad (C_{5} \quad H_{5-a-c} (R^{3})_{c}) \quad MeXY \qquad (III)$ 

[0040]

 $S_a$   $(C_5 H_{5-a-d}(R^4)_d) ZMeXY$ 

(IV)

【0041】ここで、Qは2つの共役五員環配位子を架橋する結合性基を表し、Sは共役五員環配位子とZ基を架橋する結合性基を表す。具体的には、

【0042】(イ)低級アルキレン、あるいはその低級アルキル又はフェニル置換誘導体、好ましくはメチレン、エチレン、イソプロピレン、フェニルメチルメチレン、ジフェニルメチレン、シクロへキシレン等

(ロ) シリレンないしオリゴシリレン、あるいはその低級アルキル又はフェニル置換誘導体、好ましくはシリレン、ジメチルシリレン、フェニルメチルシリレン、ジフェニルシリレン、ジシリレン、テトラメチルジシリレン

(ハ) ゲルマニウム、リン、窒素、ホウ素又はアルミニ 30 ウムを含む炭化水素基〔具体的には (CH3)2 Ge、(C6 H5)2 Ge、(C6 H5)2 Ge、(C6 H5)3 (C6 H5)3 (C4 H5)3 (C4 H5)3 (C6 H5)3 (C6 H5)3 (C6 H5)3 (C6 H5)4 (CH3 O) A1等〕等である。これらの中で、好ましくはアルキレン基又はシリレン基である。 a は 0 又は 1 である。

【0043】上記一般式において、  ${C_5 H_{5-a-b}(R^2)}$  。〕、  ${C_5 H_{5-a-c}(R^3)}$  。〕又は  ${C_5 H_{5-a-d}(R^4)}$  。〕で表される共役五員環配位子は、それぞれ別個に定義されているけれども、b、c及びd、並びに  $R^2$  、  $R^3$  及び  $R^4$  の定義そのものは同じであるから(詳細後記)、この3つの共役五員環基は同一でも異なっていてもよいことはいうまでもない。

【0044】 この共役五員環基の1つの具体例は、b=0 (c=0又はd=0) のシクロペンタジエニル基(架橋基Q又はS以外の置換基のない)である。この共役五員環基が $b\neq0$  ( $c\neq0$ 又は $d\neq0$ ) であって置換基を有するものである場合、 $R^2$  ( $R^3$  又は $R^4$ )の一つの具体例は、炭化水素基( $C_1$  ~ $C_{20}$ 、好ましくは $C_1$  ~ $C_{12}$ )であるが、この炭化水素基は1価の基としてシク

ロペンタジエニル基と結合していても、またこれが複数 個存在するときに、その2個がそれぞれの他端で相互に 結合して、当該シクロペンタジエニル基の一部と共に 環、すなわちシクロペンタジエン環との縮合環、を形成していてもよい。後者の代表例は、R²(R³又はR⁴)が 当該シクロペンタジエニル基の二重結合を共有して縮合 六員環を形成しているもの、すなわちこの共役五員環基 がインデニル基メはフルオレニル基であるものである。 すなわち、この共役五員環基の代表例は、置換者しくは 非置換の、シクロペンタジエニル基、インデニル基又は フルオレニル基である。

【0045】R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>及びR<sup>4</sup>は、それぞれ、上記の30 C<sub>1</sub> ~ C<sub>20</sub>、好ましくはC<sub>1</sub> ~ C<sub>12</sub>の炭化水素基の外に、ハロゲン原子〔例えば、フッ素、塩素、臭素〕、アルコキシ基(例えば、C<sub>1</sub> ~ C<sub>12</sub>のもの)、ケイ素含有炭化水素基〔例えば、ケイ素原子を-Si(R)(R<sup>\*</sup>)の形で含む炭素数1~24程度の基〕、リン含有炭化水素基〔例えば、リン原子を-P(R)(R<sup>\*</sup>)の形で含む炭素数1~18程度の基〕、窒素含有炭化水素基〔例えば、窒素原子を-N(R)(R<sup>\*</sup>)の形で含む炭素数1~18程度の基〕あるいはホウ素含有炭化水素基〔例えば、ホウ素原子を-B(R)(R<sup>\*</sup>)の形で含む炭素数1~18程度の基〕あるいはホウ素含有炭化水素基〔例えば、ホウ素原子を-B(R)(R<sup>\*</sup>)の形で含む炭素数1~18程度の基〕である。b(c又はd)が2以上であってR<sup>2</sup>(R<sup>3</sup>又はR<sup>4</sup>)が複数個存在するときは、それらは同一でも異なっていてもよい。

【 $0\ 0\ 4\ 6$ 】 b、c及びdは、aが $0\ 0\ c$ きは $0\le b\le 5$ 、 $0\le c\le 5$ 、 $0\le d\le 5$ を、aが $1\ 0\ c$ きは $0\le b\le 4$ 、 $0\le c\le 4$ 、 $0\le d\le 4$ を満足する整数を表す。

【0047】Meは周期律表IVB~VIB族遷移金属、好ましくはチタン、ジルコニウム又はハフニウムである。特に好ましくはジルコニウムである。

例は、炭化水素基( $C_1 \sim C_{20}$ 、好ましくは $C_1 \sim [0048]$  Zは酸素( $-O_-$ )、イオウ( $-S_-$ )、 $C_{12}$ ) であるが、この炭化水素基は1価の基としてシク 50 炭素数  $1\sim 20$ 、好ましくは  $1\sim 10$  のアルコキシ基、

炭素数1~20、好ましくは1~12のチオアルコキシ 基、炭素数1~40、好ましくは1~18のケイ素含有 炭化水素基、炭素数1~40、好ましくは1~18の窒 素含有炭化水素基、炭素数1~40、好ましくは1~1 8のリン含有炭化水素基である。 a=1のときは、Z基 の一部が結合性基であるS基と結合しているものであ る。

【0049】 X及びYは、各々水素原子; ハロゲン原 子:炭素数1~20、好ましくは1~10の炭化水素 基;炭素数 $1\sim20$ 、好ましくは $1\sim10$ のアルコキシ 10 ス(2-メチルインデニル)ジルコニウムジクロリド、 ル基:アミノ基:炭素数1~20、好ましくは1~12 のリン含有炭化水素基(具体的には、例えばジフェニル ホスフィン基);あるいは炭素数1~20、好ましくは 1~12のケイ素含有炭化水素基〔具体的には、例えば トリメチルシリル基、ピス(トリメチルシリル)メチル 基〕である。XとYとは同一でも異なっていてもよい。 これらのうちハロゲン原子、炭化水素基が好ましい。

【0050】Mcがジルコニウムである場合のこの遷移 金属化合物の具体例は、下記のとおりである。

【0051】(イ)架橋する結合基を有せず共役五員環 20 配位子を2個有する遷移金属、例えば

【0052】ビス(シクロペンタジエニル)ジルコニウ ムジクロリド、ビス(メチルシクロペンタジエニル)ジ ルコニウムジクロリド、ビス(ジメチルシクロペンタジ エニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(トリメチルシ クロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (テトラメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジ クロリド、

【0053】ビス(ペンタメチルシクロペンタジエニ ペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ビス(イン デニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (フルオレニ ル) ジルコニウムジクロリド、ビス (シクロペンタジエ ニル) ジルコニウムモノクロリドモノハイドライド、

【0054】ビス(シクロペンタジエニル)メチルジル コニウムモノクロリド、ビス(シクロペンタジエニル) エチルジルコニウムモノクロリド、ビス(シクロペンタ ジエニル) フェニルジルコニウムモノクロリド、ビス (シクロペンタジエニル) ジルコニウムジメチル、ピス (シクロペンタジエニル) ジルコニウムジフェニル、

【0055】ビス(シクロペンタジエニル)ジルコニウ ムジネオペンチル、ビス(シクロペンタジエニル)ジル コニウムジハイドライド、 (シクロペンタジエニル) (インデニル)ジルコニウムジクロリド、(シクロペン タジエニル) (フルオレニル) ジルコニウムジクロリド 等。

【0056】(ロ)アルキレン基で架橋した五員環配位 子を2個有する遷移金属化合物、例えば

【0057】メチレンピス(インデニル)ジルコニウム ジクロリド、エチレンビス(インデニル)ジルコニウム 50 オレニル)ジルコニウムジクロリド、イソプロピリデン

ジクロリド、エチレンビス (インデニル) ジルコニウム モノハイドライドモノクロリド、エチレンピス(インデ

ニル)メチルジルコニウムモノクロリド、エチレンビス (インデニル) ジルコニウムモノメトキシドモノクロリ

ド、 【0058】エチレンビス(インデニル)ジルコニウム

ジエトキシド、エチレンビス (インデニル) ジルコニウ ムジメチル、エチレンビス(4,5,6,7-テトラヒ ドロインデニル)ジルコニウムジクロリド、エチレンビ エチレンビス(2-エチルインデニル)ジルコニウムジ クロリド、

【0059】エチレンビス(2,4-ジメチルインデニ ル) ジルコニウムジクロリド、エチレン(2, 4ージメ チルシクロペンタジエニル) (3´,5´-ジメチルシ クロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、エチレ ン(2-メチル-4-tert-ブチルシクロペンタジエニ ル)(3 ~-tert-ブチル-5 ~-メチルシクロペンタ ジエニル) ジルコニウムジクロリド、エチレン(2, 3,5-トリメチルシクロペンタジエニル)(2´,4 ´, 5 ´ートリメチルシクロペンタジエニル)ジルコニ ウムジクロリド、イソプロピリデンビス (インデニル) ジルコニウムジクロリド、

【0060】イソプロピリデン(2,4-ジメチルシク ロペンタジエニル) (3´, 5´ージメチルシクロペン タジエニル) ジルコニウムジクロリド、イソプロピリデ ン(2-メチル-4-tert-ブチルシクロペンタジエニ ル) (3 -tert-ブチル-5 -メチルシクロペンタ ジエニル) ジルコニウムジクロリド、メチレン (シクロ ル) ジルコニウムジクロリド、ビス (n-ブチルシクロ 30 ペンタジエニル) (3,4-ジメチルシクロペンタジエ ニル)ジルコニウムジクロリド、メチレン(シクロペン タジエニル) (3, 4-ジメチルシクロペンタジエニ ル) ジルコニウムクロリドヒドリド、メチレン (シクロ ペンタジエニル) (3,4-ジメチルシクロペンタジエ ニル) ジルコニウムジメチル、

> 【0061】メチレン(シクロペンタジエニル)(3, 4-ジメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジフ ェニル、メチレン(シクロペンタジエニル)(トリメチ ルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、メ 40 チレン (シクロペンタジエニル) (テトラメチルシクロ ペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、イソプロピ リデン(シクロペンタジエニル)(3,4-ジメチルシ クロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、イソプ ロピリデン(シクロペンタジエニル)(2,3,4,5 -テトラメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジ クロリド、

【0062】イソプロピリデン(シクロペンタジエニ ル) (3-メチルインデニル) ジルコニウムジクロリ ド、イソプロピリデン(シクロペンタジエニル)(フル

(2-メチルシクロペンタジエニル) (フルオレニル) ジルコニウムジクロリド、イソプロピリデン(2,5-ジメチルシクロペンタジエニル) (3´, 4´ージメチ ルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、イ ソプロピリデン(2,5-ジメチルシクロペンタジエニ ル) (フルオレニル) ジルコニウムジクロリド、

【0063】エチレン(シクロペンタジエニル)(3, 5-ジメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジク ロリド、エチレン(シクロペンタジエニル)(フルオレ メチルシクロペンタジエニル) (フルオレニル) ジルコ ニウムジクロリド、エチレン(2,5-ジエチルシクロ ペンタジエニル)(フルオレニル)ジルコニウムジクロ リド、ジフェニルメチレン (シクロペンタジエニル)

(3, 4-ジエチルシクロペンタジエニル) ジルコニウ ムジクロリド、シクロヘキシリデン(シクロペンタジエ ニル) (フルオレニル) ジルコニウムジクロリド、シク ロヘキシリデン(2,5-ジメチルシクロペンタジエニ ル) (3´, 4´-ジメチルシクロペンタジエニル) ジ ルコニウムジクロリド等。

【0064】(ハ)シリレン基架橋五員環配位子を有す る遷移金属化合物、例えば

【0065】ジメチルシリレンピス(インデニル)ジル コニウムジクロリド、ジメチルシリレンビス(4,5, 6. 7-テトラヒドロインデニル) ジルコニウムジクロ リド、ジメチルシリレンビス(2-メチルインデニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリレンビス(2, 4-ジメチルインデニル)ジルコニウムジクロリド、ジ メチルシリレンビス(2-メチル-4,5,6,7-テ トラヒドロインデニル)ジルコニウムジクロリド、

【0066】ジメチルシリレン(2,4-ジメチルシク ロペンタジエニル) (3 ´, 5 ´ージメチルシクロペン タジエニル) ジルコニウムジクロリド、フェニルメチル シリレンビス (インデニル) ジルコニウムジクロリド、 フェニルメチルシリレンビス(4,5,6,7-テトラ ヒドロインデニル) ジルコニウムジクロリド、フェニル メチルシリレン(2,4-ジメチルシクロペンタジエニ ル) (3´, 5´-ジメチルシクロペンタジエニル) ジ ルコニウムジクロリド、フェニルメチルシリレン(2, , 5<sup>-</sup>-トリメチルシクロペンタジエニル)ジルコニ ウムジクロリド、

【0067】フェニルメチルシリレンビス(テトラメチ ルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ジ フェニルシリレンビス(インデニル)ジルコニウムジク ロリド、テトラメチルジシリレンビス(インデニル)ジ ルコニウムジクロリド、テトラメチルジシリレンビス (シクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、テ トラメチルジシリレン (3-メチルシクロペンタジエニ ル)(インデニル)ジルコニウムジクロリド、

【0068】ジメチルシリレン(シクロペンタジエニ ル) (3, 4-ジメチルシクロペンタジエニル) ジルコ ニウムジクロリド、ジメチルシリレン(シクロペンタジ エニル) (トリメチルシクロペンタジエニル) ジルコニ ウムジクロリド、ジメチルシリレン(シクロペンタジエ ニル)(テトラメチルシクロペンタジエニル)ジルコニ ウムジクロリド、ジメチルシリレン(シクロペンタジエ ニル) (3, 4-ジエチルシクロペンタジエニル) ジル コニウムジクロリド、ジメチルシリレン(シクロペンタ ニル) ジルコニウムジクロリド、エチレン(2,5-ジ 10 ジエニル)(トリエチルシクロペンタジエニル)ジルコ ニウムジクロリド、

> 【0069】ジメチルシリレン(シクロペンタジエニ ル) (テトラエチルシクロペンタジエニル) ジルコニウ ムジクロリド、ジメチルシリレン(シクロペンタジエニ ル) (フルオレニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチ ルシリレン (シクロペンタジエニル) (2, 7-ジ-t ブチルフルオレニル)ジルコニウムジクロリド、ジメ チルシリレン(シクロペンタジエニル)(オクタヒドロ フルオレニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリ 20 レン(2-メチルシクロペンタジエニル)(フルオレニ ル) ジルコニウムジクロリド、

> 【0070】ジメチルシリレン(2,5-ジメチルシク ロペンタジエニル) (フルオレニル) ジルコニウムジク ロリド、ジメチルシリレン(2-エチルシクロペンタジ エニル) (フルオレニル) ジルコニウムジクロリド、ジ メチルシリレン(2,5-ジエチルシクロペンタジエニ ル) (フルオレニル) ジルコニウムジクロリド、ジエチ ルシリレン(2-メチルシクロペンタジエニル)(2 ´, 7 ´ージー t ーブチルフルオレニル)ジルコニウム 30 ジクロリド、ジメチルシリレン(2,5-ジメチルシク ロペンタジエニル) (2´, 7´ージーtーブチルフル オレニル) ジルコニウムジクロリド、

【0071】ジメチルシリレン(2-エチルシクロペン タジエニル) (2´, 7´-ジ-t-ブチルフルオレニ ル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリレン (ジエ チルシクロペンタジエニル) (2´, 7´ージーtーブ チルフルオレニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチル シリレン(メチルシクロペンタジエニル)(オクタヒド ロフルオレニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシ 3,5-トリメチルシクロペンタジエニル) (2´,4 40 リレン(ジメチルシクロペンタジエニル) (オクタヒド ロフルオレニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシ リレン (エチルシクロペンタジエニル) (オクタヒドロ フルオレニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリ レン(ジエチルシクロペンタジエニル)(オクタヒドロ フルオレニル) ジルコニウムジクロリド等。

> 【0072】 (二) ゲルマニウム、アルミニウム、ホウ 素、リンあるいは窒素を含む炭化水素基で架橋された五 員環配位子を有する遷移金属化合物、例えば

【0073】ジメチルゲルマニウムビス(インデニル) 50 ジルコニウムジクロリド、ジメチルゲルマニウム (シク

ロペンタジエニル) (フルオレニル) ジルコニウムジクロリド、メチルアルミニウムビス (インデニル) ジルコニウムジクロリド、フェニルアルミニウムビス (インデニル) ジルコニウムジクロリド、フェニルホスフィノビス (インデニル) ジルコニウムジクロリド、

【0074】エチルホラノビス(インデニル)ジルコニウムジクロリド、フェニルアミノビス(インデニル)ジルコニウムジクロリド、フェニルアミノ(シクロペンタジエニル)(フルオレニル)ジルコニウムジクロリド、等が例示される。

【0075】(ホ)五員環配位子を1個有する遷移金属 化合物、例えば

【0076】ペンタメチルシクロペンタジエニルビス (フェニル) アミドジルコニウムジクロリド、インデニルビス (フェニル) アミドジルコニウムジクロリド、ペンタメチルシクロペンタジエニルビス (トリメチルシリル) アミドジルコニウムジクロリド、ペンタメチルシクロペンタジエニルフェノキシジルニウムジクロリド、ジメチルシリレン (テトラメチルシクロペンタジエニル)フェニルアミドジルコニウムジクロリド、

【0077】ジメチルシリレン(テトラメチルシクロペンタジエニル)-tert-ブチルアミドジルコニウムジクロリド、ジメチルシリレン(インデニル)シクロヘキシルアミドジルコニウムジクロリド、ジメチルシリレン(テトラヒドロインデニル)デシルアミドジルコニウムジクロリド、ジメチルシリル)アミドジルコニウムジクロリド、ジメチルゲルマン(テトラメチルシクロペンタジエニル)(フェニル)アミドジルコニウムジクロリド、等が例示される。

【0078】(へ)また、上記(イ)~(ホ)の化合物の塩素を臭素、ヨウ素、ヒドリド、メチル、フェニル等に置きかえたものも使用可能である。

【0079】更に、本発明では、成分(i)として上記(イ)~(へ)に例示したジルコニウム化合物の中心金属をジルコニウムからチタン、ハフニウム、ニオブ、モリブデン又はタングステンに換えた化合物も用いることができる。

【0080】これらのうちで好ましいのは、ジルコニウム化合物、ハフニウム化合物又はチタニウム化合物である。より好ましいのはアルキレン基若しくはシリレン基で架橋したチタニウム化合物、ジルコニウム化合物又はハフニウム化合物である。

【0081】(ii) 成分(ii) は、(イ) アルミニウム オキシ化合物、(ロ) ルイス酸、又は(ハ) 成分(i) と反応して成分(i) をカチオンに変換することが可能 なイオン性化合物である。

【0082】ルイス酸のあるものは、「成分(i)と反応して成分(i)をカチオンに変換することが可能なイオン性化合物」として捉えることもできる。したがっ

12

て、「ルイス酸」及び「成分 (i) と反応して成分 (i) をカチオンに変換することが可能なイオン性化合物」の両者に属する化合物は、いずれか一方に属するものと解することとする。

【0083】アルミニウムオキシ化合物としては、具体的には下記の一般式 (V)、(VI) 又は (VII)で示される化合物がある。

[0084]

【化1】

10 
$$R^{5}$$

$$A 1 + (0 - A 1) + 0 - A 1$$

$$R^{5}$$

$$R^{6}$$

$$R^{6}$$

$$R^{6}$$

$$R^{6}$$

[0085]

[化2]

[0086]

【化3】

20

$$\begin{array}{c|c}
R^{a} & R^{a} & R^{a} \\
& & | & \\
& A & 1 - O - B - O - A & 1 \\
& & & \\
R^{a} & & & \\
\end{array}$$
(VII)

【0087】(式中、pは0~40、好ましくは2~3 000整数であり、R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup>及びR<sup>8</sup> は各々水素 原子又は好ましくは炭素数1~10、より好ましくは炭 素数1~6の炭化水素基を表す)

【0088】一般式(V)及び(VI)の化合物は、アルモキサンとも呼ばれる化合物であって、1種類のトリアルキルアルミニウム、又は2種類以上のトリアルキルアルミニウムと水との反応により得られる生成物である。具体的には、(イ)1種類のトリアルキルアルミニウムと水から得られるメチルアルモキサン、エチルアルモキサン、プロピルアルモキサン、ブチルアルモキサン、イソブチルアルモキサン、(ロ)2種類のトリアルキルアルミニウムと水から得られるメチルエチルアルモキサン、メチルプチルアルモキサン、メチルプチルアルモキサン、メチルプチルアルモキサン、メチルイソプチルアルモキサン等が例示される。これらの中で、特に好ましいのはメチルアルモキサ又はメチルイソプチルアルモキサンである。

【0089】これらのアルモキサンは、各群内及び各群間で複数種併用することも可能であり、また、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソプチルアルミニウム、ジメチルアルミニウムクロリド等の他のアルキルアルミニウム化合物と併用することも可能

である。

【0090】これらのアルモキサンは公知の種々の方法 で調製することができ、具体的には以下のような方法が 例示される。

【0091】(イ)トリアルキルアルミニウムをトルエ ン、ベンゼン、エーテル等の適当な有機溶剤を用いて直 接水と反応させる方法、(ロ)トリアルキルアルミニウ ムと結晶水を有する塩水和物、例えば硫酸銅、硫酸アル ミニウムの水和物と反応させる方法、(ハ)トリアルキ ルアルミニウムとシリカゲル等に含浸させた水分とを反 10 応させる方法、(二) トリメチルアルミニウムとトリイ ソブチルアルミニウムを混合し、トルエン、ベンゼン、 エーテル等の適当な有機溶剤を用いて直接水と反応させ る方法、

【0092】(ホ)トリメチルアルミニウムとトリイソ ブチルアルミニウムを混合し、結晶水を有する塩水和 物、例えば硫酸銅、硫酸アルミニウム等の水和物と加熱 反応させる方法、(へ)シリカゲル等に水分を含浸さ せ、トリイソブチルアルミニウムで処理した後、トリメ チルアルミニウムで追加処理する方法、(ト)メチルア ルモキサン及びイソブチルアルモキサンを公知の方法で 合成し、これら二成分を所定量混合し、加熱反応させる 方法、(チ)ベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素溶 媒に硫酸銅5水塩などの結晶水を有する塩を入れ、-4 0~40℃位の温度条件下トリメチルアルミニウムと反 応させる方法。この場合、使用する水の量は、トリメチ ルアルミニウムに対してモル比で通常0.5~1.5で ある。このようにして得られたメチルアルモキサンは、 線状又は環状の有機アルミニウムの重合体である。

【0093】一般式 (VII) で示される化合物は、1種 類のトリアルキルアルミニウム、又は2種類以上のトリ アルキルアルミニウムと下記の一般式(VIII)

[0094]

 $R^9 - B - (OH)_2$ (IIIV)

【0095】で示されるアルキルボロン酸(式中、R® は炭素数1~10、好ましくは炭素数1~6のアルキ基 を表す)とのモル比10:1~1:1の反応により得る ことができる。具体的には、(イ)トリメチルアルミニ ウムとメチルボロン酸の2:1の反応物、(ロ)トリイ 物、(ハ)トリメチルアルミニウムとトリイソブチルア ルミニウムとメチルボロン酸の1:1:1の反応物、

(二) トリメチルアルミニウムとエチルボロン酸の2: 1の反応物、及び(ホ)トリエチルアルミニウムとブチ ルボロン酸の2:1の反応物等が例示される。これらの 一般式 (VII)の化合物は、複数種用いることも可能であ り、また一般式(V)又は(VI)で示されるアルモキサ ンや、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウ ム、トリイソブチルアルミニウム、ジメチルアルミニウ 14

することも可能である。

【0096】また、成分(i)と反応して成分(i)を カチオンに変換することが可能なイオン性化合物として は、一般式(IX)で示されるものがある。

[0097]

 $(K)^{e^+}(Z)^{e^-}$ (IX)

【0098】ここで、Kはイオン性のカチオン成分であ って、例えばカルボニウムカチオン、トロピリウムカチ オン、アルモニウムカチオン、オキソニウムカチオン、 スルホニウムカチオン、ホスフォニウムカチオン等が挙 げられる。また、それ自身が還元されやすい金属の陽イ オンや有機金属の陽イオン等も挙げられる。これらのカ チオンの具体例としては、(イ)トリフェニルカルボニ ウム、ジフェニルカルボニウム、シクロヘプタトリエニ ウム、インデニウム、トリエチルアンモニウム、トリプ ロピルアンモニウム、トリブチルアンモニウム、N, N ジメチルアニリニウム、ジプロピルアンモニウム、ジ シクロヘキシルアンモニウム、トリフェニルホスホニウ ム、トリメチルホスホニウム、トリ(ジメチルフェニ 20 ル) ホスホニウム、トリ (メチルフェニル) ホスホニウ ム、トリフェニルスルホニウム、トリフェニルオキソニ ウム、トリエチルオキソニウム、ビリリウム、及び銀イ オン、金イオン、白金イオン、銅イオン、パラジウムイ オン、水銀イオン、フェロセニウムイオン等がある。

【0099】上記の一般式(IX)におけるZはイオン性 のアニオン成分であり、成分(i)が変換されたカチオ ン種に対して対アニオンとなる成分(一般には非配位 の) であって、例えば、有機ホウ素化合物アニオン、有 機アルミニウム化合物アニオン、有機ガリウム化合物ア 30 ニオン、有機リン化合物アニオン、有機ヒ素化合物アニ オン、有機アンチモン化合物アニオンなどが挙げられ る。具体的には、(イ)テトラフェニルホウ素、テトラ キス(3,4,5-トリフルオロフェニル) ホウ素、テ トラキス(3,5-ジ(トリフルオロメチル)フェニ ル) ホウ素、テトラキス(3,5-ジ(t-ブチル)フ ェニル)ホウ素、テトラキス(ペンタフルオロフェニ ル)ホウ素、(ロ)テトラフェニルアルミニウム、テト ラキス(3,4,5-トリフロオロフェニル)アルミニ ウム、テトラキス〔3,5-ジ(トリフルオロメチル) ソプチルアルミニウムとメチルボロン酸の2:1の反応 40 フェニル〕アルミニウム、テトラキス[3,5-ジ](t ブチル)フェニル〕アルミニウム、テトラキス(ペン タフルオロフェニル) アルミニウム、(ハ) テトラフェ ニルガリウム、テトラキス(3,4,5-トリフルオロ フェニル) ガリウム、テトラキス〔3, 5 – ジ(トリフ ルオロメチル) フェニル〕 ガリウム、テトラキス〔3, 5-ジ(t-ブチル)フェニル〕ガリウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ガリウム、(ニ) テトラフ ェニルリン、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) リ ン、(ホ)テトラフェニルヒ素、テトラキス(ペンタフ ムクロリド等の他のアルキルアルミニウム化合物と併用 50 ルオロフェニル) ヒ素、(へ) テトラフェニルアンチモ

ン、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)アンチモ ン、(ト)デカボレート、ウンデカボレート、カルバド デカボレート、デカクロロデカボレート等が例示され る。

【0100】また、ルイス酸、特に成分(i)をカチオ ンに変換可能なルイス酸、としては、種々の有機ホウ素 化合物、金属ハロゲン化合物、又は固体酸等が例示され る。具体的には、(イ)トリフェニルホウ素、トリス (3,5-ジフルオロフェニル) ホウ素、トリス(ペン タフルオロフェニル) ホウ素等の有機ホウ素化合物; (ロ) 塩化アルミニウム、臭化アルミニウム、ヨウ化ア ルミニウム、塩化マグネシウム、臭化マグネシウム、ヨ ウ化マグネシウム、塩化臭素マグネシウム、塩化ヨウ化 マグネシウム、臭化ヨウ化マグネシウム、塩化マグネシ ウムヒドリド、塩化マグネシウムヒドロオキシド、臭化 マグネシウムヒドロオキシド、塩化マグネシウムアルコ キシド、臭化マグネシウムアルコキシド等の金属ハロゲ ン化合物;又は(ハ)シリカーアルミナ、アルミナ等の 固体酸等が挙げられる。

【0101】これらのイオン性化合物やルイス酸は、成 20 圧下で反応させることができる。 分(ii)として単独で用いることもできるし、一般式 (V)、(VI) 又は(VII)のアルミニウムオキシ化合物 と併用することができる。また、トリアルキルアルミニ ウム、ジアルキルアルミニウムモノハライド、モノアル キルアルミニウムジハライド及びアルキルアルミニウム セスキハライド、並びにこれらのアルキル基の一部がフ ェノキシ基と替ったもの、これらの具体例としてはトリ メチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイ ソブチルアルミニウム、ジエチルアルミニウムフェノキ シド、ジメチルアルミニウムクロリド等の有機アルミニ 30 ウム化合物と併用することも可能である。

【0102】 (iii)本発明の好ましい触媒は、上記の成 分(i)及び成分(ii)を、重合槽内で又は重合槽外 で、重合させるべきモノマーの存在下若しくは非存在下 に接触させることにより得ることができる。

【0103】本発明で使用する成分(i)及び成分(i i)の使用量は任意である。例えば溶媒重合の場合、成 分(i)の使用量は遷移金属原子として10<sup>-1</sup>~10<sup>2</sup> ミリモル/リットル、10-4~1ミリモル/リットルの 合、A1/遷移金属のモル比は通常10~100,00 0、100~20, 000が好ましく、100~10, 000の範囲がより好ましい。一方、成分(ii)として イオン性化合物又はルイス酸を用いた場合は、対遷移金 属のモル比で0.1~1,000、好ましくは0.5~ 100、より好ましくは1~50の範囲で使用される。

【0104】本発明の触媒は、成分(i)及び(ii)以 外に、他の成分を含み得るものであることは前記したと おりであるが、成分(i)及び(ii)に加えることが可 タノール、エタノール、ブタノール等の活性水素含有化 合物;エーテル、エステル、アミン等の電子供与性化合 物:ホウ酸フェニル、ジメチルメトキシアルミニウム、 亜リン酸フェニル、テトラエトキシシラン、ジフェニル ジメトキシシラン等のアルコキシ含有化合物等が挙げら れる。

【0105】〈ブロック共重合体の製造〉本発明におけ るブロック共重合体の製造方法は、成分(a)及び成分 (b) をヒドロシリル化により結合させることであり、 10 ヒドロシリル化に使用するシラン又はポリオルガノハイ ドロジェンシロキサンとしては、Si-H結合を1分子 中に2個以上有すればよい。

【0106】このようなシラン又はポリオルガノハイド ジェンシロキサンの具体例としては、ジエチルシラン、 フェニルシラン、メチルフェニルシラン、ポリメチルハ イドロジェンシロキサン、ポリフェニルハイドロジェン シロキサン等が挙げられる。

【0107】反応条件は-100~300℃、好ましく は-50~200℃の温度で、常圧下、減圧下、又は加

【0108】 反応溶媒としては、例えば脂肪族炭化水素 溶媒、脂環式炭化水素溶媒、芳香族炭化水素溶媒、非プ ロトン性極性溶媒等が使用できるが、成分(a)及び (b) を反応温度でともに溶解し得るものが好ましい。

【0109】また、必要により反応を促進するための触 媒を使用してもよい。触媒としては、Pt、Rh、P d、Ni等の遷移金属化合物が通常用いられる。これら の具体例としては塩化白金酸 (H2 PtCl2)等が挙げ

【0110】反応時間は各種反応条件により任意に設定 できる。

【0111】本発明で得られるブロック共重合体を通常 の用途の供するときは、同共重合体中には未反応の成分 (a) 及び成分(b) を含んでいてもよい。

## [0112]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明を具体的に説明 するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0113】参考例1:4-ペンテニルリチウムの製造 高真空下、ブレークシール法を用いて以下の製造を行っ 範囲内がより好ましい。アルミニウムオキシ化合物の場 40 た。すなわち、金属リチウム 5g 及び5 - プロモー1 -ペンテン6g をn-ヘプタン120mlに加えて、室温で 3日間反応させた。次に、該反応液にジエチルエーテル 40mlを加え、0℃で24時間撹拌後ろ過し、そのろ液 の溶媒を留去した。 <sup>1</sup>H-NMR分析により、ビニル基 及びメチルアニオン由来のピークが観察され、4-ペン テニルリチウムが得られたことが確認された。収率は7 0%であった。

> 【0114】参考例2:末端に不飽和結合を有するポリ スチレンの合成

能な第三成分(任意成分)としては、例えば $H_2$  O、メ 50 参考例1と同様高真空下、ブレークシール法を用いて行

った。

17

った。すなわち、参考例1で得た4ーペンテニルリチウム0.08gをnーヘプタン9.3mlで希釈し、これをスチレン6.2gとベンゼン200mlを混合した溶液に撹拌下に滴下し、室温で2時間重合させた後、メタノール2mlを加えて重合を停止させた。この反応液をメタノール1L中へ注ぎ、沈殿したポリマーをろ別乾燥した。得られたポリマー(以下「樹脂A」という)は6.2gであり、GPC測定の結果、Mnは6,270、重量平均分子量(以下「Mw」という)は8,080であった。「H-NMR分析により、樹脂Aのポリスチレン主10鎖に由来するピーク強度と未端ビニル基に由来するピーク強度の比から、ポリマーの片末端すべてにビニル基が導入されていることが確認された。

【0115】参考例3:未端に不飽和結合を有するポリスチレンの合成

参考例2において4ーペンテニルリチウムの量を0.0m] 分率は0.4g、スチレンの量を7.0gに換えた以外、参考例2か結合であったと同様に行った。得られたポリマー(以下「樹脂B」という)は6.9gであり、GPCの測定の結果、Mnは14,400、Mwは15,600であった。樹脂Bの20日ピレンの合成未端にもすべてビニル基が導入されていることが「Hータオ例4と同様に20日ピレンの合成を表例4においるの分析からわかった。

【0116】参考例4:末端に不飽和結合を有するポリプロピレンの合成

(1) エチレンピス(インデニル)ジルコニウムジクロ リドの製造

充分に窒素置換した 300 nl ガラス製フラスコに、ビス (インデニル) エタン 5.16g 及びテトラヒドロフラン 150 nl を装入し、-78 C まで冷却した。これにプチルリチウム(Aldrich社製) 25 nl (濃度 1.6 E ルノ 30 U ットル) を 1 時間かけ滴下し、還流温度まで徐々に昇温し、その後 2 時間還流させた。

【0117】一方、充分に窒素置換した200mlガラス製フラスコにテトラヒドロフランを100ml装入後、-78℃まで冷却し、それに四塩化ジルコニウム4.7gを加え、室温まで徐々に昇温した。この四塩化ジルコニウム溶液を、上記ビス(インデニル)ジルコニウムのリチウム塩溶液中に、0℃にて一括添加し、その後、還流温度まで昇温し16時間還流温度にて反応を続けた。生成した黄色固体をろ別し、メタノールで洗浄し、減圧下40で乾燥した。1.9gのエチレンビス(インデニル)ジルコニウムジクロリドが得られた。

【0118】(2)メチルアルモキサンの製造

 18

【0119】(3)重合

撹拌機及び温度制御装置を備えた内容積1.0Lのステンレス鋼製オートクレーブに、充分に脱水及び脱酸素したトルエン400ml、メチルアルモキサン580mg及びエチレンビス(インデニル)ジルコニウムジクロリド0.418mg(0.001mmol)を導入し、プロピレン圧力7kg/cm² G、40 Cで4時間重合させた。重合終了後、重合溶液を3Lのメタノール中に抜き出し、重合体をろ別し乾燥させたところ、180gの樹脂(以下「樹脂C」という)が回収された。GPC測定の結果、このものはMn18,700、分子量分布(Mw/Mn)1.99であった。

【0120】<sup>13</sup>C-NMR(日本電子社製、商品名:JEOL.FX-200)分析の結果トリアッドの[mm]分率は0.888であり、片側末端は全てビニリデン結合であった(1,000炭素原子当り0.79個)。

【0121】参考例5:未端に不飽和基を有するポリプロピレンの合成

参考例4において重合温度を20℃に換えた以外は、参考例4と同様に行い、43gの樹脂(以下「樹脂D」という)を得た。このもののMnは32, 500、Mw/Mnは1.93であった。

【0122】参考例6:プロピレンと1,9-デカジエンの共重合体の合成

(1) 固体触媒成分(i) の製造

充分に窒素置換したフラスコに、脱水及び脱酸素したn ーヘプタン 200 ml を導入し、次いでMgC12 を 0.4 モル、 $Ti(O-nC4H_9)4$  を 0.8 モル導入し、95 で 2 時間反応させた。反応終了後、40 でに温度を下げ、次いでメチルヒドロポリシロキサン(20cSのもの) 48 ml を導入し、3 時間反応させた。生成した固体成分をn-ヘプタンで洗浄した。

【0123】次いで充分に窒素置換したフラスコに上記と同様に精製したn-ヘプタン50 mlを導入し、上記で合成した固体成分をM g原子換算で0.24 モル導入した。ついでn-ヘプタン25 mlにS i C 14 0.4 モルを混合して30  $\mathbb C$ 、30 分間でフラスコへ導入し、70  $\mathbb C$ で3時間反応させた。反応終了後、n-ヘプタンで洗浄した。次いでn-ヘプタン25 mlにフタル酸クロライド0.024 モルを混合して、70  $\mathbb C$  、30 分間でフラスコへ導入し、90  $\mathbb C$  で 1 時間反応させた。

【0124】反応終了後、n-ヘプタンで洗浄した。次いで $SiC1_420$ mlを導入して80℃で6時間反応させた。反応終了後、n-ヘプタンで充分に洗浄した。この成分のチタン含量は、1.21重量%であった。

に昇温して2日間反応させた。残存する硫酸銅の固体を 【0125】充分に窒素置換したフラスコに充分に精製分離し、アルモキサンのトルエン溶液を得た。メチルア したn-ペプタンを50 ml 導入し、次いで上記で得た成ルモキサンの濃度は27.3 mg/ml(2.7 w/v %) であ 50 分を5 g 導入し、次いで( $CH_8$ )。 $CSi(CH_8)$ (O

CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> 〔成分(ii)〕を1.6ml導入し、次いでTi C14 0. 52ml、更にトリエチルアルミニウム3. 0 g をそれぞれ導入し、30℃で2時間接触させた。接触 終了後、n-ヘプタンで充分洗浄して、固体成分(i) とした。固体成分(i)中のチタン含量は、3.64重 量%であった。

【0126】充分に窒素置換した内容積1.5Lの撹拌 式オートクレーブに、脱水及び脱酸素したn-ヘプタン 400mlを導入し、系内を15℃に冷却した後、成分 (ii) としてn-ブチルリチウム0. 4g 及び上記固体 成分(i) 4g を導入し、プロピレンを8g/hrで0.5 時間フィードして予備重合を行なった。プロピレンフィ ード終了後、10分間残圧重合を行った。終了後、n-ヘプタンで2回洗浄して、目的の重合用触媒成分を得 た。この重合用触媒成分4g上には、ポリマーが3.7 2g あり、重合用固体触媒成分(i)が7.72g 得ら れた。

## 【0127】(2) 共重合体の製造

内容量10Lのオートクレーブをプロピレンで置換した ニウム2. 5g 及び上記固体触媒成分(i) 0. 4g を プロピレン雰囲気下に導入した。

【0128】次いで撹拌しながらプロピレンを圧入し、 65℃、0. 5 kg/cm<sup>2</sup> Gに10分間保持した。この後、 1,9-デカジエンの装入を開始し、同時にプロピレン で2. 0 kg/cm<sup>2</sup> Gに加圧保持した。1, 9 - デカジエン は350ml/hr で2時間装入した。なお、固体触媒成分 (i) を導入する直前から重合終了時まで、オートクレ ーブ気相部の水素濃度を4.0体積%に保持した。5時 間後n-ブタノールで触媒を不活性化した後、触媒残渣 30 を水で抽出し遠心分離により共重合体を回収し、乾燥し た。

【0129】得られた共重合体(以下「樹脂E」とい う) パウダーは、2. 1kgであり、かさ密度は0.51 g/ccであった。GPC測定の結果Mnは56,000、 Mwは350,000であった。また「H-NMRによ る分析により、共重合された1,9-デカジエンの含有 量は0.33モル%であった。

### 【0130】実施例1

充分に窒素置換した200mlフラスコに、樹脂C 1. 3g 、樹脂A 1.3g 、充分に脱水及び脱酸素したキ シレン40ml、ポリメチルハイドロジェンシロキサン (信越化学工業社製、商品名:KF99) 0. 025g 及び白金/ジビニルテトラメチルジシロキサン(信越化 学工業社製、商品名: PL50T) 0. 014g を入 れ、窒素雰囲気下、160℃で144時間反応させた。

【0131】その後、反応溶液をメタノール500mlへ 注ぎ、沈殿したブロック共重合体をろ別・乾燥し、2. 5g を得た。

【0132】このブロック共重合体2g をキシレン10 *50* 込み沈殿させ、固体生成物を回収し乾燥した。この固体

20

0mlに加熱溶解した後、メチルエチルケトン500mlへ 加え沈殿したブロック共重合体をろ別・乾燥した。回収 されたブロック共重合体は1.9g であり、赤外線分光 分析法により、そのスチレン含量は49.0重量%であ った。GPC測定の結果、このものはMn25,00 0、Mw51,000であった。

### 【0133】 実施例2

実施例1において、樹脂C 0.65g、樹脂A 1. 9 5g に換えた以外、同例と同様に行い、ブロック共重 10 合体 2. 4g を得た。

> 【0134】実施例1と同様に精製処理及び分析を行な った結果、回収されたブロック共重合体は1.8gであ り、スチレン含量は60重量%であった。またMn2 9,000、Mw66,000であった。

### 【0135】実施例3

実施例1において、樹脂Cを樹脂Dに、また、樹脂Aを 樹脂Bに換えた以外、同例と同様に行いブロック共重合 体2. 5g を回収した。

【0136】実施例1と同様に精製処理及び分析を行っ 後、n-ヘプタン 2. 5L を仕込み、トリエチルアルミ 20 た結果、回収されたブロック共重合体は 1. 5g であ り、スチレン含量は31.1重量%であった。またMn 53, 600、Mw108, 000であった。

### 【0137】実施例4

実施例1において、樹脂Cを樹脂Eに換えた以外、同例 と同様に行いブロック共重合体2.5g を回収した。

【0138】実施例1と同様に精製処理及び分析を行っ た結果、回収されたブロック共重合体は1. 7g であ り、スチレン含量は38.8重量%であった。またMn 63,000、Mw360,000であった。

### 【0139】比較例1

充分に窒素置換した丸底フラスコ内に、樹脂C5g と四 塩化炭素200mlを入れ、70℃に昇温し、同温度で3 0 分間撹拌した後、撹拌下に室温まで冷却した。そこへ 臭素 0. 18g を加え、1時間反応させた後、60℃に 昇温して30分間更に反応させた。

【0140】次いで、フラスコ内に内容物をメタノール 21 中に加えて1時間撹拌し、吸引ろ過して固体生成物 をろ別した。更に固体生成物をメタノールに加えてろ過 する操作を4回繰返した後、固体生成物を乾燥して4.

98g の臭素化重合体を得た。イオンクロマトグラフィ 一にて臭素含量を測定した結果3.3重量%であった。

【0141】フラスコ内に、スチレン6.7g、キシレ ン115mlを加え、そこへn-ブチルリチウム49mgを 加え、リビングポリスチリルアニオンを合成した。

【0142】別のフラスコ内へ上記臭素化重合体1.0 g を入れ、キシレン120mlを加え、50℃で撹拌し た。そこへ前記リビングポリスチリルアニオンを加え、 50℃で144時間撹拌して反応させた。

【0143】ついで大過剰のメタノール中へこれを注ぎ

生成物を1,4-ジオキサンに2時間還留溶解させてか ら一夜20℃に放置した後、不溶部をろ別回収して乾燥 した。

【0144】得られたポリマーは1.01g であり、赤 外線吸収スペクトルよりポリスチレンの含量を求めたと ころ、6.5重量%であった。また、イオンクロマトグ ラフィーにて臭素含量を測定した結果、1.5重量%で あった。

### 【0145】応用例1及び2

実施例1で得たブロック共重合体、ポリプロピレン(三 10 長さ31.5mm、幅6.2mm、厚さ3.2mmの試験片を 菱油化社製;商品名"MA8")及びポリ(2,6-ジ メチル-1, 4-フェニレンエーテル) (日本ポリエー テル社製、30℃におけるクロロホルム中で測定した固 有粘度: 0. 4 dl/g) を応用例1として表1に示す組成 で、内容積60mlのプラストミル(東洋精機製作所社 製)を用い230℃で5分間、回転数180rpm で溶融\*

\*混練した。得られた樹脂組成物を、下記によって物性を 評価し、結果を表1に示した。ブロック共重合体を使用 しなかった場合を応用例2 (比較) として、同様に表1 に示した。

22

# 【0146】(1)曲げ弾性率

幅25㎜、長さ80㎜の試験片を切削加工し、JIS K 7203に準拠してインストロン試験機を用いて測 定した。

### 【0147】(2)アイゾット衝撃強度

射出成形し、アイゾット衝撃試験機(カスタム・サイエ ンスティフィック社製ミニマックスCS-138TI 型) を用いて、ノッチ有りアイゾット衝撃強度を測定し た。

[0148]

【表1】

表1

		応 用	例
		1	2 (比較)
	(ポリプロピレン (MA8)	50	50
配合組成(重量部)	   ポリ(2,6-ジメチル-1,4   -フェニレンエーテル)	50	50
	   ブロック共重合体 (実施例1)	20	0
初加维	(アイゾット衝撃強度(kg·cm/cm²)	6. 8	2.1
評価結果・	曲 げ 弾 性 率 (kg/cm²)	13,000	13, 000

## [0149]

【発明の効果】本発明の製造方法によれば、それ自体が 優れた耐衝撃性を有し、かつ優れた機械的強度を有する 熱可塑性樹脂が得られるとともに、ポリオレフィン、ポ

リスチレン又はポリフェニレンエーテル等に対する優れ た改質材並びにポリフェニレンエーテルとポリオレフィ ン又はポリオレフィンとハイインパクトポリスチレンと の優れた相溶化剤が得られる。